文章编号:0258-7025(2002)02-0107-03

# 射频激励铜离子激光器阻抗特性 实验研究

# 黄建军<sup>1</sup>,余建华<sup>2</sup>,D. Teuner<sup>3</sup>

(深圳大学<sup>1</sup>理学院实验中心<sup>?</sup>光电子系,广东深圳518060<sup>?</sup>德国鲁尔大学电子工程与信息技术系,德国波鸿D-44780)

提要 利用自行研制的传感器和测量装置,通过对射频放电电压电流以及其相位角的测定,结合放电管的等效电路,对射频激励激光器阻抗特性进行研究,得出射频激励激光器等离子体的伏安特性曲线,以及等离子体电阻、容 抗与气体压强、放电电流之间的实验曲线。

关键词 射频放电 阻抗特性 等效电路模型

中图分类号 TN 248.2+5 文献标识码 A

# Experimental Study on Impedance Characteristics of the Cu Ion Laser at RF Discharge Excitation

HUANG Jian-jun<sup>1</sup>, YU Jian-hua<sup>2</sup>, D. Teuner<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Experimental Center of School of Science , <sup>2</sup>Department of Optical Electrics , Shenzhen University , Shenzhen 518060

<sup>3</sup>Department of Electrical Engineering and Information Technology , D-44780 Bochum Germany ,

**Abstract** The impedance characteristics of RF discharge CW laser are studied by measuring the current, voltage and phase angle. The *V-I* characteristic, impedance and capacitance of the RF discharge plasma changing with the gas pressure and current are given.

Key words RF discharge , equivalent electrical circuit model , impedance characteristics

# 1 引 言

由于分布电容的存在而造成对测量仪器的干扰,使得对射频放电电压电流及相位的测量到目前 为止仍然是比较困难和昂贵的;使用简单的电压电 流探头而无干扰地精确测量出电压、电流和相位角, 从而计算出功率和复合阻抗几乎是不可能的。通过 自行研制的传感器<sup>11</sup>,以网络分析理论为基础,采用 数字与计算机技术,对射频放电电压、电流、相位角 以及功率进行精确的测量,结合等效电路模型得到 等离子体阻抗的相关信息。

# 2 RF 放电电压电流的测量原理

一个线圈就可以组成一个简便的电流探头,用 来测量和电流成正比的磁场强度 H,但是要想完全 屏蔽电场对电流探头干扰是很困难的,因此仪表得 到的电流示值,我们用 S<sub>I</sub>表示,是 RF 电压 U 和电流 I 共同叠加作用的结果

$$S_I = a_{11}I + a_{12}U \tag{1}$$

电压探头通常采用容性分压器,用来测量和电压成 正比的电场强度 *E*。同样由于电流形成的磁场的耦 合,使仪表得到的电压示值,*S*<sub>U</sub>是 RF 电压 U和电流 I 共同叠加作用的结果

收稿日期 2001-01-31; 收到修改稿日期 2001-03-19

基金项目 广东省自然科学基金( 编号 980922 )资助项目。

作者简介 ;黄建军( 1862— ) 男 ,深圳大学理学院高级实验师 ,学士( 目前为中国科学院等离子体物理研究所培养博士研究

生),主要从事应用等离子体技术研究。E-mail :huangjj@szu.edu.cn

(2)

$$S_U = a_{21}I + a_{22}U$$

从(1)和(2)式可以看出,要想精确地测量 RF 电压 U和电流 I,必须首先得到系数  $a_{xx}$ 。通常情况希望  $a_{12},a_{21}$ 为零,而  $a_{11},a_{22}$ 为实数。但令人遗憾的是, 在高频情况下这是很难实现的,或者说要实现是非 常昂贵的。如果使用已知阻值和性质的负载,在输入 已知功率的前提下,就可以对传感器进行校正得到 系数  $a_{xx}$ ,这样 RF 电压 U 和电流 I 就可以通过下式 计算得到

$$\begin{pmatrix} I\\ U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}a_{12}\\ a_{21}a_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} S_I\\ S_U \end{pmatrix}$$
(3)

进而通过计算 Z = U/I,就可以得到激光放电管的 总阻抗 Z,U,I相位角。这里(1)~(3)式中的各量 均为复数,电压和电流的相互叠加的结果,不仅影响 探头电压和电流输出示值的幅值,而且影响它们的 相位。测量出 U,I之后,在无射频放电的情况下,测 出放电管阻抗  $Z_0 = (j\omega C_0)^{-1}$ 计算出  $C_0$ ,电极间的 电容  $C_{P0}$ 则可用公式  $C_{P0} = \epsilon_0 \epsilon_r A/d$ 计算得出,式中  $\epsilon_0$ 为真空介电常数, $\epsilon_r$ 为相对介电常数,A为电极的 面积,d为电极间的距离;则分布电容  $C_S = C_0 - C_{P00}$ 实际测量得  $C_0 = 33$  pF,计算  $C_{P0}$ 约1.8 pF。图 1 为激光管结构剖面图,考虑到分布电容的存在,其 等效电路如图 2 所示<sup>[2]</sup>,由图 2 得

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{U} = \left(\frac{1}{Z_P} + j\omega C_S\right)$$
(4)

则 ,等离子体阻抗

$$Z_P = \left(\frac{1}{Z} - j\omega C_S\right)^{-1} \tag{5}$$

根据欧姆定律  $I_P = U/Z_P$  求得放电电流  $I_P$  ,进而得 出  $R_P I_P$  及  $X_C I_P$  之间的关系。



#### 图 1 激光管结构的剖面图及参数

of the laser tuber

electrode area :  $4\times 200~\mathrm{mm}^2$  ; electrode distance : 4mm ;

#### quartz tube : internal diameter 15 mm

### 3 实验装置

图 3 为实验装置图。测量探头结构详见文献 [13],匹配网络采用 L型,因为 L型匹配网络的传 输效率较  $\pi$  型高出  $15\%^{[4]}$ ;射频功率计采用日本 DAIWA 公司的产品,最大量程为 1.5 kW;RF 功率发 生器采用德国 Huettinger 公司生产的,频率为 13.56 MHz,最大功率输出为 1 kW;50  $\Omega$  校正传感器假负 载(High-Power Attenuator)为德国 Rohde & Schwarz 公 司生产的,其技术指标为 40 dB,0~1 GHz 的带宽, 功率为 1 kW;数字存储示波器为美国 Tektronic 公司 生产的 TDS360,双通道(分别输入  $S_I$ , $S_U$ ),带宽为 1 GHz。

## 4 实验结果

对上述激光管充 He 气 压强从 3 kPa 到 10 kPa, 输入射频功率从 10 至 80 W,频率为 13.56 MHz,在 实现匹配的情况下(电压驻波比(VSWR)约为 1.1), 分别测量出激光管通过的电流、端电压以及其相位, 结合放电管的等效电路模型计算出通过等离子体的 电流及其阻抗 图 4 为不同气压和输入功率下放电 装置的伏 安 特 性 曲 线,图 5(a)为不同 气压下等离子体电阻随电流变化的关系曲线,图



#### 图 2 激光管等效电路

U 测量电压 ;I 测量电流 ; $I_p$  穿过等离子体的放电电流 ; $I_s$  ;穿过 寄生电容的电流 ; $C_s$  :激光管寄生电容 ; $R_p$  :等离子体电阻 ; $C_p$  :等 离子体电容 ; $Z_p$  :等离子体阻抗  $R_p + \frac{1}{j\omega C_p}$  ;Z :激光管总的 等效阻抗

#### Fig.2 Equivalent electrical circuit of the laser tube

U: measured voltage ; I: measured current ;  $I_P$ : discharge current through plasma ;  $I_S$ : current flowing through stray capacitance ;  $C_S$ : laser tube stray capacitance ;  $R_P$ : plasma resistance ;  $C_P$ : plasma capacitance ;  $Z_P$ : plasma impedance  $R_P + \frac{1}{j\omega C_P}$ ; Z: overall equivalent

impedance of the laser tube





图 3 实验装置图

Fig.3 Experimental setup



图 4 放电装置伏安特性曲线

Fig.4 Voltage as a function of current



#### 图 5 等离子体电阻(*a*)及等离子体容抗(*b*)与电流 密度关系曲线

Fig. 5 Real part of the plasma( *a* ) and imaginary part of the plasma( *b* ) as a function of the current density

5(b)为不同气压下等离子体容抗随电流变化的关系曲线。

# 5 结 论

使用经校正的传感器可以精确地测量出放电电 压、电流及其相位角。放电管的总阻抗表现出容性、 电压和电流间的相位角,与充入气体的压强有关,其 范围为 – 84° <  $\varphi$  < – 68°。放电管总阻抗的实部小 于 60  $\Omega$ ,虚部在 200 ~ 300  $\Omega$  之间,其伏安特性近似 直线,表明放电管总阻抗变化较小,放电电流大部分 流过分布电容  $C_{s}$ 。

同放电管总阻抗有所不同,等离子体阻抗的实部和虚部在同一个数量级,其范围在 300 Ω < Z < 2000 Ω,且随着电流密度和气体压强的增加而同步减少,表明随着放电电流密度的增加,欧姆能量损耗在增加,次级电子发射和电离能力增加,放电的维持机制趋同于空心阴极放电(HCD)。

致谢 本课题得到德国研究协会低温等离子体特别 研究小组(SFB191)提供在德国期间合作研究的资 助 特别是在德期间得到了德国鲁尔大学电子工程 系的 J. Mentel 教授和 Schulze 博士在实验室设备和 技术以及其他方面的大力支持,对此向他们表示衷 心的感谢。

#### 参考文献

- 1 Huang Jianjun, Yu Jianhua, D. Teuner. The probe measuring voltage, current and the phase angle of RF discharges [J]. *Instrument Technique and Sensor* (仪表技术与传感器), 2000,(11):1~2(in Chinese)
- 2 M. A. Sobolewski. Electrical characteristics of argon radio frequency glow discharges in an asymmetric cell [ J ]. *IEEE Trans. Plasma Sci.*, 1995, 23(6):1006 ~ 1022
- 3 Huang Jianjun, Yu Jianhua, D. Teuner. Measurement of voltage current phase angle and power at RF discharges [J]. *Electrical Measurement & Instrumentation* (电子测量与仪 表),2000,(9)25~27(in Chinese)
- 4 Mohamed Salem, J.-F. Loiseau, B. Held. Impedance matching for optimization of power trancer in a capacitively excited RF plasma reactor[J]. The European Physical Journal : *Applied Physics*, 1998, **3** 91 ~ 95